W2105-01

## POST PROCESSING OF PHOTOSENSITIVE RESIN PRINTING PLATE

Patent number:

JP6282082

**Publication date:** 

1994-10-07

Inventor:

KANETAKA SHINYA; NISHIHARA SEIKI; TANAKA

SHINICHI

Applicant:

**TOYO BOSEKI** 

**Classification:** 

- international:

B41N3/00; G03F7/00; G03F7/40; B41N3/00; G03F7/00;

G03F7/40; (IPC1-7): G03F7/40; B41N3/00; G03F7/00

- european:

Application number: JP19930071992 19930330 Priority number(s): JP19930071992 19930330

Report a data error here

#### Abstract of JP6282082

PURPOSE:To prevent defective printing durability by exposing and developing an original printing plate including a photosensitive resin composition contg. org. acid salts, a cover film, etc., and bringing the obtained resin printing plate into contact with org. and/or inorg. acids. CONSTITUTION:An original printing plate including a substrate, a photosensitive resin composition layer contg. org. acid salts and a cover film is exposed and developed to form a photosensitive resin plating plate, and the printing plate is brought into contact with org. and/or inorg. acids. The composition layer contains the unit of an org. acid salt in the polymer or monomer constituting the composition, a functional group such as-(CO2)nM<n+> (M is groups I to III elements, amines and ammonium) is exemplified as the org. acid salts. Consequently, water developability and ink resistance are maintained, the printing durability is improved, and the damage of the relief surface of the printing plate, i.e., defective printing durability, caused after a fixed number of prints are formed is eliminated.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-282082

(43)公開日 平成6年(1994)10月7日

(51) Int.Cl.5		識別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G03F	7/40	5 2 1	7124-2H		
B41N	3/00		7124-2H		
G03F	7/00	502	7124-2H		

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

000003160	
東洋紡績株式会社	
大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号	
金高 慎也 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内	
西原 誠喜	
滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内	
田中 新一 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 績株式会社総合研究所内	
人会孩相还没有日名	

## (54) 【発明の名称】 感光性樹脂印刷版の後処理方法

## (57)【要約】

【目的】 水現像性および耐インキ性を維持しつつ、耐 駅性の向上した感光性樹脂版を得ること。

【構成】 少なくとも支持体、有機酸の塩を含有する感光性樹脂組成物層およびカパーフィルムを含む印刷原版を露光、現像を行なうことによって感光性樹脂印刷版を作製した後、該印刷版に有機および/または無機酸を接触させることを特徴とする感光性樹脂印刷版の後処理方法。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも支持体、有機酸の塩を含有する 感光性樹脂組成物層およびカパーフィルムを含む印刷原 版を露光、現像を行なうことによって感光性樹脂印刷版 を作製した後、該印刷版に有機および/または無機酸を 接触させることを特徴とする感光性樹脂印刷版の後処理 方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 100011

【産業上の利用分野】本発明は、感光性樹脂印刷版、特に水現像フレキソ印刷版を作製後、該版を酸に接触させることにより、その耐刷性を飛躍的に向上させるという感光性樹脂印刷版の後処理方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、感光性樹脂印刷版の耐水化あ るいは耐刷性を向上させるために種々の方法が提案さ れ、例えば後処理方法としては、水酸基を含有する高分 子化合物を使用する感光性樹脂版をアセタール化して耐 水化する方法(特公昭52-23281号公報)、蘇光、現像後 のスルホン酸ナトリウム基及び/またはスルホン酸カリ ウム基を有するポリアミドを含有する感光性樹脂を飲布 したスクリーン印刷版を二価以上のカチオンを含む溶液 で処理することにより容易に感光性樹脂層の膨潤を押さ える方法(特開昭52-143104 号公報)、樹脂を用いる印 刷用版材にプラズマを当てて改質処理を行い、耐刷力を 向上させ、使用インキの自由度を増加させる方法(特公 昭57-6107号公報) 等がある。また耐水性あるいは耐刷 性に関する後処理方法以外として、イソプレンのような 共役ジエン系モノマーセグメントを主鎖中にもつ可溶性 ポリマー、フマル酸エステルまたはマレイン酸エステル のようなエチレン性不飽和単量体、及び光重合開始剤か ら形成された感光性樹脂組成物を露光、現像、乾燥の工 程の後、200~300mm の波長範囲の光を殺菌灯、低圧水 銀灯を用いて照射する方法(特開昭55-13583号公報)が ある.

【0003】また、露光後の感光性樹脂組成物の表面粘着性を除去する方法としては、キノン系化合物やベンゾフェノンのような活性カルボニル基をもつ水素引き抜き剤のエタノール溶液に浸漬処理する方法(特開昭53-143669)がある。さらに未製版の印刷版に対する後処理方法に関しては、炭素-炭素不飽和結合を有する物質を含有するフレキソ印刷版の表面をアルキルハイボハライド、N,N-ジハロスルホン酸アミド基含有化合物等の活性ハロゲン含有化合物で処理することにより、未製版の感光性フレキソ印刷版の表面粘着性を無くして、解像度の向上を図る方法(特開昭61-262742号公報)がある。

【0004】ところで本発明者らは、組成物全重量に対 ルセルロースなどの汎用樹脂の他に(メタ)アクリル酸する親水性高分子の量を少量加えることで水現像性と耐 とジェン化合物を共重合させたジェン系ゴム、無水マレインキ性の両方を満足する水現像フレキソ刷版を本発明 イン酸で変性した液状ポリプタジェン、また特に効果的以前に開発している。ところが現実には水現像性付与と 50 な骨格としては-CO-M (M は周期律表第1、11、III 族

耐インキ性との両立はかなり難しく、このフレキソ刷版 を用いて多量部数の印刷を行なったところ、ある部数印 刷した後の印刷物にかすれ等が見られ、レリーフの表面 を観察すると、レリーフ表面に欠けや摩耗などの損傷が

## みられた。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、感光性樹脂 印刷版、特に水現像フレキソ刷版の印刷時における前記 従来の欠点、即ち一定部数印刷した時に起こる印刷版の レリーフ表面の損傷、つまり耐刷性不良を解消すること を課題とするものである。

#### {0006}

【課題を解決するための手段】そこで本発明者らは、上記課題である耐刷性を向上すべく鋭意、努力、検討、研究した結果、遂に本発明を完成するに到った。即ち本発明は、少なくとも支持体、有機酸の塩を含有する感光性樹脂組成物層およびカバーフィルムを含む印刷原版を露光、現像を行なうことによって感光性樹脂印刷版を作製した後、該印刷版に有機および/または無機酸を接触さ20 せることを特徴とする感光性樹脂印刷版の後処理方法である。

【0007】本発明における感光性樹脂組成物層とは、
均一系の樹脂であっても多相系の樹脂であってもよいが、いずれの場合も構成しているポリマーあるいは単量体の少なくとも一種類のポリマーあるいは単量体一分子中に少なくとも一個の有機酸の塩のユニットを含んでいることが必要である。有機酸の塩とは、 -(CO2-) . M \*\*、-(SO3-) . M \*\*、-(PO3E (13-\*)-)M(13-\*)+(Mは周期律表第I、II、III族元素、アミン、アンモニウムを示す)等の官能基である。また特に効果的な有機酸の塩のユニットしては-CO2M (M は周期律表第I、II、II 族元素、アミン、アンモニウムを示す)であり、前記周期律表第I、1I、III 族元素としては、ナトリウム、カリウム、リチウムなどのアルカリ金属、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属、ホウ素、アルミニウムなどが挙げられる。

【0008】均一系の樹脂および多層系の樹脂としては以下の(A) 成分を含むものである。(A) 成分とは、親水性ポリマーであり、これは水、または水を主成分として、アルカリ性水溶液、酸性水溶液、有機溶剤、または界面活性剤等を含む現像液に可溶あるいは膨潤(分散)するポリマーを意味し、一CO2M、-SO8M、一PO3M (A) は周期律表第1、II、III 族元素、アミン、アンモニウムを示す)-NE、-OH 等の親水基を有し、かつ線状で架橋の無いポリマーである。このような親水性ポリマーの例として、ポリビニルアルコール(PVA)、カルボキシメチルセルロースなどの汎用樹脂の他に(メタ)アクリル酸とジエン化合物を共重合させたジエン系ゴム、無水マレイン酸で変性した液状ポリブタジエン、また特に効果的な骨格としては一CO2M (M) は周期律表第1、II、III 族

元素、アミン、アンモニウムを示す)を50~50,000当量 /10°g 有するボリマーであり、前記周期律表第 I、II、III 族元素としては、ナトリウム、カリウム、リチウムなどのアルカリ金属、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属、ホウ素、アルミニウムなどが挙げられる。なお本発明において-C02M 基が50当量/10°未満では水に対する親和性が劣り中性水で現像することが難しく、一方50,000当量/10°g を超えると、耐インキ性が劣るので好ましくない。

【0009】親水性ポリマーとして具体的には-CO<sub>2</sub>M 基 10 含有ポリウレタン、-CO2M 含有ポリウレアポリウレタ ン、-CO2M 基含有ポリエステル、-CO2M 基含有エポキシ 化合物、-CO<sub>2</sub>M 基含有ポリアミド酸、-CO<sub>2</sub>M 基含有アク リロニトリループタジエンコポリマー、-CO2M 基含有ス チレンープタジエンコポリマー、-CO2M 基含有ブタジエ ン、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸ナトリウム、 ポリピニルアルコール(PVA)、カルポキシメチルセルロ ース(CMC) 、ヒドロキシエチルセルロース(HEC)、メチ ルセルロース(MC)、ポリエチレンオキサイド、ポリエチ レンイミン、及び該当化合物誘導体等が使用できるが、 これらに限定されるものではない。なお前記親水性ポリ マーに含有されるためにカルボキシル基の少なくとも一 部を中和するために使用される化合物としては、水酸化 リチウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等アルカ・ リ金属の水酸化物、炭酸リチウム、炭酸カリウム、炭酸 ナトリウム等の炭酸アルカリ金属塩、カリウムープトキ サイド、ナトリウムメトキサイド等のアルカリ金属のア ルコキサイド、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウ ム、水酸化アルミニウム等の多価金属の水酸化物、アル ミニウムイソプロポキサイドを初めとする多価金属アル 30 コキサイド、トリエチルアミン等の第3 級アミン、ジエ チルアミン、ジ-p- プロピルアミン等の第2級アミン、 n-プロピルアミン第1級アミン、モルホリン等の環状ア ミン、N.N-ジメチルアミノエチル (メタ) アクリレー ト、N.N-ジエチルアミノエチル (メタ) アクリレート等 アミノ基含有(メタ)アクリレート、炭酸アンモニウム 塩等を挙げることができる。 これらは、単独あるいは複 数組み合わせて使用してもよい。なお本発明において親 水性成分として前記親水性ポリマー以外に例えば、水酸 基、アミノ基、スルホン酸基等の親水基および/あるい 40 はポリオキシアルキレン鎖を有するポリマーなどを併用 してもよい。

【0010】木発明において、(A) 成分からなる均一系の感光性樹脂、あるいは(A) 成分を含む多相系感光製樹脂からなる印刷版中の感光性樹脂の単位重量(グラム)に対して10-a mol/g ~1mol/gの酸を接触させることが好ましい。具体的には、感光性樹脂の単位重量(グラム)に対し、1ml ~10-ml の容積を有する容器中に10-5 mol/L ~10-1 mol/Lの酸の有機溶剤溶液を満たし、この中にレリーフ作製後の印刷版を1分~10-6 分侵す。そして要件 50

の下限をはずれる場合には、一定時間以内に期待する効 果を得ることができないという欠点を生じ、本発明の目 的とする効果が得られなくなる。また、逆に要件の上限 をはずれる場合には、組成物自体が分解あるいは劣化を 引き起こしてしまうという欠点を生じ、本発明の目的と する効果が得られなくなる。また本発明を簡便に行なう ために有機溶剤の溶液にして用いることは特に好まし い。酸として具体的には、プロトン性の酸であり、弗化 水素、塩化水素、臭化水素、ヨウ化水素などのハロゲン 化水素、硫酸、亜硫酸、硝酸、亜硝酸、オルトリン酸、 メタリン酸、ポリリン酸、炭酸、次亜塩素酸、塩素酸、 過塩素酸、過ヨウ素酸、過マンガン酸、重クロム酸等の オキソ酸あるいはそれらの誘導体等が挙げられる。また プロトン性の有機酸としては、蟻酸、酢酸あるいはプロ ピオン酸等の一価のカルボン酸を含む酸、シュウ酸、マ ロン酸、コハク酸、マレイン酸等の二価のカルボン酸を 含む酸、あるいはこれらの誘導体である三価あるいは四 価のカルポン酸を含む酸等が挙げられる。プロトン性の 有機酸としては、直鎖状であっても分岐状であってもよ く、また骨格が飽和結合のみでつながったものでも不飽 和結合を含んでいるものでもよい。またこれらの有機酸 は少なくとも炭素を1 個以上含んでいればいかなる分子 量のものでもよい。またフェノールおよびフェノール誘 導体あるいはシリカゲルのような水酸基を有する酸でも

【0011】また酸を有機溶剤の溶液として用いる場合 に好ましい有機溶剤としては、メタノール、エタノー ·ル、n-プロパノール、iso-プロパノール、n-プタノー ル、iso-プタノール、sec-ブタノール、t-プタノール等 のアルコール類あるいはその誘導体であり、エチレング リコール、グリセリンおよびその誘導体のように多価の アルコールでもよい。またジエチルエーテル、テトラヒ ドロフラン等のエーテル類、ペンタン、ヘキサン、ヘブ タン等の飽和炭化水素類、ペンゼン、トルエン、キシレ ン、メシチレン等の芳香族炭化水素およびクロロベンゼ ン、ニトロペンゼン等の芳香族化合物、酢酸エチル等の エステル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭 素、トリクロロエタン等のハロゲン化炭化水素、ジメチ ルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類、 アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類等が挙げら れる。なお本発明において前記酸と接触させる時期とし ては、露光、現像後であればいつでもよく、後露光、乾 燥、その他の処理と前後してもよい。

[0012]

【作用】本発明方法を採用するとにより、耐刷性が飛躍的に向上する理由としては、露光、現像して得られた印刷版を酸と接触させることにより、感光層中の親水性部分が疎水化して、耐インキ性等を向上させるためと思われる。

0 {0013}

【実施例】以下参考例および実施例を用いて本発明を具 体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので はない。

#### 参考例1

ポリテトラメチレングリコール17部、2.2-ジヒドロキシ メチルプロピオン酸36部、ヒドロキシエチルメタアクリ ル酸15部、テトラヒドロフラン180 部、ヘキサメチレン ジイソシアナート69部を重合缶に仕込み、これに予めア クリロニトリル・ブタジエン共重合物の両末端カルボキ シル化合物の2-アミノエチルピペラジンとの縮合物 107 10 部をテトラヒドロフラン154部に室温で溶解した溶液を 常温窒素雰囲気下で室温で投入し撹拌する。引き続いて 温度を65℃に昇温し、10時間撹拌して、ポリマー溶液を 得た。これに水酸化リチウム0.6部、水酸化カルシウム 7.3 部を加えて、40℃以下で10時間撹拌して塩化して親 水性ポリマーaを得た。

#### 【0014】参考例2

ポリテトラメチレングリコール17部、2,2-ジヒドロキシ メチルプロピオン酸36部、ヒドロキシエチルメタアクリ ル酸15部、テトラヒドロフラン180 部、ヘキサメチレン 20 ジイソシアナート69部を重合缶に仕込み、これに予めア クリロニトリル・プタジエン共重合物の両末端カルボキ シル化合物の2-アミノエチルピペラジンとの縮合物107 部をテトラヒドロフラン154 部に室温で溶解した溶液を 常温窒素雰囲気下で室温で投入し撹拌する。引き続いて 温度を65℃に昇温し、10時間撹拌して、ポリマー溶液を 得た。これに水酸化ナトリウム1部、酢酸マグネシウム 14部を加えて、40℃以下で10時間撹拌して塩化し、親水 性ポリマーbを得た。

### 【0015】参考例3

ポリテトラメチレングリコール17部、2,2-ジヒドロキシ メチルプロピオン酸36部、ヒドロキシエチルメタアクリ ル酸15部、テトラヒドロフラン180 部、ヘキサメチレン ジイソシアナート69部を重合缶に仕込み、これに予めア クリロニトリル・プタジエン共重合物の両末端カルボキ シル化合物の2-アミノエチルピペラジンとの縮合物107 部をテトラヒドロフラン154 部に室温で溶解した溶液を 常温窒素雰囲気下で室温で投入し撹拌する。引き続いて 温度を65℃に昇温し、10時間撹拌して、ポリマー溶液を 得た。これに水酸化リチウム0.6 部、酢酸マグネシウム 14部を加えて、40℃以下で10時間撹拌して塩化し、親水 性ポリマーc を得た。

#### 【0016】参考例4

ポリテトラメチレングリコール17部、2,2-ジヒドロキシ メチルプロピオン酸36部、ヒドロキシエチルメタアクリ ル酸15部、テトラヒドロフラン180 部、ヘキサメチレン ジイソシアナート69部を重合缶に仕込み、これに予めア クリロニトリル・プタジエン共重合物の両末端カルボキ シル化合物の2-アミノエチルピペラジンとの縮合物107

常温室素雰囲気下で室温で投入し撹拌する。引き続いて

温度を65℃に昇温し、10時間撹拌して、ポリマー溶液を 得た。これに水酸化カリウム1.4 部、酢酸カルシウム15 部を加えて、40℃以下で10時間撹拌して塩化し、親水性 ポリマーdを得た。

#### 【0017】参考例5

参考例1から4において得られた有機酸塩を有する親水 性ポリマーa~dをそれぞれる部、塩素化ポリエチレン 20部、スチレンプタジエンゴムも部、プタジエンオリゴ アクリレート14部、ペンジルメチルケタール0.5 部、ハ イドロキノンモノメチルエーテル0.25部、水、メチルエ チルケトンおよびテトラヒドロフランの混合溶媒55部を それぞれ混合して、感光性樹脂組成物A~Dを得た。

#### 【0018】 実施例1

参考例5に従って得られた感光性樹脂でに、あるパター ンを持ったネガを置き、製版機(A&V社製) を用いて露光 するしたものを現像機を用いて現像した後、乾燥するこ とによって得られたレリーフを0.12mol/L の塩酸メタノ ール溶液100mlに4時間浸した後、減圧乾燥機にて乾燥 させた。このレリーフを用いて印刷を行なったところ、 150 万部印刷したところでも印刷物に文字のかすれ等は みられなかった。この際にレリーフの表面を観察すると レリーフ表面に欠けや摩耗が見られなかった。

#### 【0019】 実施例2、3

参考例5に従って得られた感光性樹脂AおよびBに、あ るパターンを持ったネガを置き、製版機(A&V社製)を用 いて露光するしたものを現像機を用いて現像した後、乾 燥することによって得られたレリーフをそれぞれ0.06mo 1/L の硫酸エタノール溶液100ml に 4 時間浸した後、減 圧乾燥機にて乾燥させた。このレリーフを用いて印刷を 行なったところ、いずれも150 万部印刷したところでも 印刷物に文字のかすれ等はみられなかった。この際にレ リーフの表面を観察するとレリーフ表面に欠けや摩耗が 見られなかった。

## 【0020】 実施例4

参考例5に従って得られた感光性樹脂Dに、あるパター ンを持ったネガを置き、製版機(A&V社製) を用いて露光 するしたものを現像機を用いて現像した後、乾燥するこ とによって得られたレリーフを0.5mol/Lの酢酸メタノー ル溶液100ml に4時間浸した後、減圧乾燥機にて乾燥さ せた。このレリーフを用いて印刷を行なったところ、15 0 万部印刷したところでも印刷物に文字のかすれ等はみ られなかった。この際にレリーフの表面を観察するとレ リーフ表面に欠けや摩耗が見られなかった。

## 【0021】比較例1

参考例5に従って得られた感光性樹脂Cに、あるパター ンを持ったネガを置き、製版機(A&V社製) を用いて露光 するしたものを現像機を用いて現像した後、乾燥するこ とによって得られたレリーフを酸による後処理を全くし 部をテトラヒドロフラン154 部に室温で溶解した溶液を 50 ないで、そのままを用いて印刷を行なったところ30万部

印刷終了時に印刷物に文字のかすれがみられた。この際 にレリーフの表面を観察するとレリーフ表面に欠けや摩 耗が見られた。

[0022]

【発明の効果】以上かかる構成よりなる本発明方法は複

雑な装置や工程を必要とせず、ただ酸に接触させるだけであり、本発明方法を採用することにより、水現像性および耐インキ性を維持しつつ、耐刷性を約5倍以上も向上させることができるので、産業界に寄与すること大である。